Erratum

Caractérisation électrique des interfaces P^+ -Si-poly/N-c-Si réalisées par dépôt LPCVD de films fortement dopés *in situ* au bore

M. Akani, C.E. Benouis et M. Benzohra

J. Phys. III France **3** (1993) 1675-1687

La liste des auteurs (et leur adresse) concernant cet article sont à corriger comme suit :

The list of authors (and the address) for this article are to be corrected as follows:

M. Idrissi-Benzohra, M. Akani, C.E. Benouis, M. Benzohra

Laboratoire d'Analyse des Composants au Silicium
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran
Oran El-Mnaouer 31000, Algérie